

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第11回研究会【洗浄の基礎科学と最前線】開催ご案内

主催：(公社)砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
共催：金沢工業大学 FMT 研究所, 協力：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第11回研究会を【洗浄の基礎科学と最前線】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日時：2018年7月24日(火) 13:00~20:00
(研究会・・・13:00~17:20, 拡大技術交流会・・・17:40~20:00)

開催場所：金沢工業大学KIT 虎ノ門大学院 (愛宕東洋ビル 13F)

【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】

〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F
(TEL : 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分



委員長 畝田道雄 (金沢工業大学)

内容：

「テーマ：洗浄の基礎科学と最前線」

13:00~13:10 開会挨拶

13:10~17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:10~13:50 電子デバイスの製造プロセスにおけるスプレー式洗浄技術

愛知工業大学 工学部 電気学科 教授 清家善之 氏

2) 13:50~14:30 半導体枚葉洗浄の現状と展望

株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ 基幹技術開発部 副部長 佐藤雅伸 氏

3) 14:30~15:10 超音波洗浄の現状と最新動向 (仮題)

株式会社カイジョー 超音波機器事業部 開発技術部 部長 長谷川浩史 氏

15:10~15:30 休憩

4) 15:30~16:20 機能水によるダメージレス洗浄 (仮題)

オルガノ株式会社 産業プラント本部 プラント事業部

エレクトロニクスビジネスユニット次長 二ツ木高志 氏

<特別講演>

5) 16:20~17:10 研磨と洗浄 その出会いとケミストリー

株式会社フジミインコーポレーテッド 新規事業本部長 森永 均 氏

17:10~17:20 閉会の挨拶

副委員長 會田英雄 (長岡技術科学大学)

17:40~20:00 拡大技術交流会 (会場を移して実施します・・・会場は現在調整中です。)

参加費：6,000円。当日徴収致します。会場は金沢工業大学KIT 虎ノ門大学院の会議室です。

※研究会(講演会)終了後には場所を移し「拡大技術交流会(会費：4,000円)」を開催します。※

参加申込締切：平成30年6月29日(金)

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 工学部 機械工学科 精密工学(畝田)研究室

KENMA 研究会事務局 竹澤瑛里子

TEL : 076-248-1100

E-mail : unc-asst@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※メールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第11回研究会」参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会	拡大技術交流会	
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		